COMMISSIONING OF PHOTOCATHODE RF GUN BASED MICROTRON AT JAERI-KANSAI

M. Kando^{1*}, H. Kotaki¹, S. Kondo¹, T. Hosokai¹, T. Yokoyama¹, S. Kanazawa¹ H. Dewa^{1†}, K. Nakajima^{1,2}, F. Sakai³, T. Ishizuka³, and T. Hori³

¹ Advanced Photon Research Center, Kansai Research Establishment

Japan Atomic Energy Research Institute (JAERI), Umemidai, Kizu, Souraku, Kyoto 619-0215, Japan

² High Energy Accelerator Research Organization (KEK), Oho, Tsukuba, Ibaraki 305-0801, Japan

³ Sumitomo Heavy Industries, Ltd. (SHI), Tanashi, Tokyo 188, Japan

Abstract We started to construct a high quality electron beam injector that consists of a photocathode rf gun and a racetrack microtron last summer. This injector will be used the second generation laser wakefield acceleration experiment at JAERI-Kansai. Beam commissioning of the system is started from this March and we succeeded in generating a 150 MeV electron single bunch with a charge of 91 pC at 10 Hz. Overview of the system and the present status of beam commissioning are described.

原研関西フォトカソード RF ガン - マイクロトロンのコミッショニング

1. はじめに

日本原子力研究所関西研究所光量子科学研究セン ターは,高ピーク出力レーザーの開発とその応用研 究に関する研究を行っている.昨年5月に京都府相楽 郡木津町に新しい研究施設が完成し,本格的に研究が 開始された.我々のグループでは,レーザー航跡場加 速による従来の原理検証実験から一歩進んだ,エネル ギー利得1GeVおよびエネルギースペクトルの改善を 目標とした第二世代の実証実験を行うために準備を進 めており,その中で高品質な電子源は欠くことのでき ない装置である.我々は高品質電子入射装置として, 高品質電子源であるフォトカソード RF 電子銃 (以下 RFガン)[1]を用い,また,小型でブースターとして 住友重機械工業(SHI)製のレーストラック型マイク ロトロン(RTM)[2]を組合わせた,世界でも初めて のシステムを構築することにした [3].

RFガンの性能試験は平成9年度から東京大学,KEK, SHIと共同して進めてきた.同時に RTM の改造設計 を行い, SHI による製作も進められた. 平成 11 年 8 月から関西研究所の新しい実験施設に RTM の搬入設 置が始まり,同年12月までにはほとんどの機器の据 付けが終わり, RF ガンのエージングを開始した.平 成12年3月からはRTMへのビームコミッショニング を開始した.本発表では,この加速器システムの概要 と性能,およびビームコミッショニングの現状につい て報告する.

2. 加速器システムの概要

加速器システムの構成を図1に,全景を図2に示す. 電子銃は, BNL タイプの RF ガンを用い, 照射用レー ザーは,全固体 Nd:YLF レーザーシステムで,世界最 高水準のエネルギー安定度を誇っている.この RF ガ

ンの特性については,昨年の研究会でも報告した[4] ので詳細は述べないが,エネルギー3.5 MeV,エミッ タンス ~ 1–10 $\pi\mu m$, パルス幅 5–10 ps, 電荷量最大 3 nC の電子シングルバンチを発生させることができ る.電子銃からの電子ビームは,入射ビーム輸送系を 通して RTM にシケイン磁石の1つを通して入射され る.シケインを使用する理由は入射軸は RTM の直線 部であり,周回軌道にバンプを作るためである.直線 部には定在波型加速空胴(ライナック)があり,入射 電子は1ターン目は約6MeVに加速され,主電磁石 前に置かれた逆磁場と主電磁石の磁場により 180° 偏 向されて再びライナックに入射される.つまり入射方 向とは逆方向に加速され,以降は同じ周回方向で23 回周回し,1周回当り6MeVの加速を受け最終的には 150 MeV まで到達し,ビーム取り出し系を通して射出 される.1-2 ターン目で複雑な加速方法を採用したの は RTM が本来は熱電子銃の低いエネルギー(80-120 keV)の入射を考慮されて設計されているからである. 取り出し系は RTM での分散を補償する系となってい る.この加速器システムの主要な設計パラメータを表 1 に示す.

2.1 計算器コードによる設計

RTM は熱電子銃を用いて稼働実績のある装置であ るが、今回の RF ガンの採用により RTM と入射系の 改造が必要となった. RTM では,入射エネルギーの 増大に伴い,1ターン目のエネルギー利得を従来の6 MeV から 2.5 MeV に下げ,かつ,2 ターン目以降の エネルギー利得は 6 MeV としなければならない.こ のため,ライナックの位置の調整が必要となった.ま た,入射に用いるシケイン電磁石の強度も高くなるた め,シケインでのバンプ軌道も大きくなり,周回軌道 への影響も考慮する必要が生じた.これらの見積もり には RTM の設計に製作されたコード MIC を使用した

^{*} Email:kando@apr.jaeri.go.jp, Phone:0774-71-3384

[†]現在,高輝度光科学研究センター所属

[5].RTMのアクセプタンスは,水平方向 $54 \pi \mu m$, 垂 直方向 $34 \pi \mu m$, 縦方向 0.11 deg. MeV (バンチ長 6 ps,エネルギー分散 7%)であった.入射系の設計は, 輸送行列による計算, *TRACE-3D*, *PARMELA*を用い て行われた.入射系は短バンチの効果による空間電荷 効果の影響が大きく,現状では最適化されていない. シケインの効果を入れた計算では,入射電子に対する 射出電子の数の割合(透過率)は26%が得られた.こ れは従来の熱電子銃を用いた場合(約8%)に比べて大 幅に向上している.



図 1: フォトカソードマイクロトロンシステムの概観.



図 2: フォトカソードマイクロトロンの全景.

2.2 高周波・トリガー系

クライストロンは Thomson 製の TH2129 を使用し 周波数は 2856 MHz,最大出力は 15MW で,そのうち 10 MW が RF ガンに,5 MW が RTM のライナックに 使われる.それぞれの RF 立体回路系にはモータ駆動 のパワーバリエータが付いており,それぞれの電力を 可変にできる.また,ライナック側には移相器があり, RF ガンに対するライナックの位相を調整できる.RF のパルス幅は,半値全幅で 6 μ s,平坦部で 1.5 μ s,パ ルス電圧平坦度は 0.3 % である.導波管内は 2 kgf/cm² の圧力の SF₆ ガスで満たされている.立体回路系に はアーク検出器が 3 ヶ所に取付られ,立体回路内での アーク放電を監視している.

レーザーとの同期は次の様に行っている.まず 2856MHzの発振器から分岐させたものを 1/36 に分 周し(79.33 MHz)タイミングスタビライザーに入力 し、レーザー発振器の周波数および位相を一定となる 表 1: フォトカソード RTM の設計仕様

Photocathode RF gun	
入射エネルギー	3.5 MeV
入力電力	6 MW (10 MW max.)
加速電場	100 MV/m
量子効率	0.5 – $1 imes10^{-4}$
Racetrack Microtron	
射出エネルギー	150 MeV
エネルギー分散	0.1 %
rms エミッタンス	${\sim}10\pi\mu{ m m}$
パルス長	\sim 5 ps (FWHM)
主磁場強度	1.23 T
磁場勾配	0.14 T/m
逆磁場強度	0.3 T
入力 RF 電力	3 MW (5 MW max.)
透過率	26%
RF	
周波数	2856 MHz
RF パルス幅	$6 \mu m s$
パルス電圧平坦度	0.3 %
繰返し	60 Hz

ように制御している.また,繰返し周波数はライン同 期モードのときは,ライン周波数60Hzの整数分の 1まで対応できる.外部同期の場合は繰返しは60Hz を越えない自由な値が許される.この繰返し周波数と RF周波数は同期回路によってRF(79.3MHz)に同期 させ,ポッケルスセル用のトリガとして用いている. このシステムでの電子ビームとレーザービームのタイ ミングジッターについては今後測定を行う予定である が,過去の実績から数 ps 程度と予想している.

2.3 冷却系

冷却系は, RF ガン, ライナック, RTM 磁石系等の 3系統から構成され, おのおの温度制御は独立に行われる.それぞれの設定温度は, 42° C, 32° C, 28° Cであり, 三方弁により温度は制御され, RF ガン, ライ ナックの水温安定度は $\pm 0.1^{\circ}$ Cが目標値となっている. 現状では, 10 Hz 運転においては RF ガンは 0.1° C 以内は達成されており, ライナック側の水温は, $-0.1 \sim +0.9^{\circ}$ C の範囲と悪く,現在原因を調査している.

2.4 真空系

RTM は 550ℓ/s のターボ分子ポンプ 2 台で排気され, 真空度は 1×10^{-7} Torr である.RF ガンは高量子効率 を達成するために高真空が要求されるため, 300 ℓ/s の イオンポンプと 500 ℓ/s NEG (nonevaporable getter) ポ ンプで排気され,RF を印加しない場合の真空度はイ オンポンプ部で 1×10^{-9} Torr となっている.RF 印加 時には $1 \times 10^{-9} - 1 \times 10^{-8}$ Torr となる.

2.5 モニター系

入射系には圧空可動式の銅製ファラデーカップ(FC), アモルファスコアモニタ(ACM),4-ポジションプロファ イルモニタ(FPM)がある.FPMには,OTR 測定用 のAIミラー,厚さ100μmのデマルケスト製蛍光板 (AF995R),0.1 mm 刻みのスケールがあり,圧空に よって各ポジションに駆動されるようになっている. RTMにはライナック前後と5ターン目までの軌道上 にデマルケストプロファイルモニタ(PM)があり,1 ターン目と3ターン目には100倍の電圧増幅器付きの コアモニタがある.また,RTMの主電磁石で発生す るシンクロトロン放射光を測定するCCDカメラ(SR 光モニタ)が2台取り付けられている.1つは全ター ン(実際には5-25ターン)の放射光をモニタするも ので,もう1つは24,25ターンを拡大して観察でき るようになっており,どちらもズーム,フォーカス, 絞りをリモートで制御できる.ビーム取出し系(以下 BT系)にはACM,2つのPM,入射系と同等のFPM が整備されている.最下流のビームダンプは電流計と しても機能する.

3. コミッショニング

ビームコミッショニングの当面の目標は,エネルギー 150 MeV,平均電流値0.5 nA以上の電子ビームを発 生させ,施設検査(6月13日予定)に合格すること である.施設検査時には上記電流値をある程度保持し なければならないため,安定度も要求される.平均電 流値で0.5 nAとは繰返し10 Hz でパルス当たりの電 荷量50 pCに相当する.

RF ガンは,加速電界が高い(100 MV/m)のが特長 であるが,反面,RF エージングに時間を必要とする. 我々は昨年12月後半からRF ガンのエージングを開 始した.詳細は小瀧の発表[6]を参照されたい.現状 では10 Hz,7 MWの入力が可能となっている.しか し,高周波立体回路系でのアーク放電の頻発や4月上 旬のRF ガンのRF 窓からのリークトラブルなどのた め,現状では,繰返しを定格の60 Hz までは上げれず, 10 Hz まででビーム調整を行った.調整時のRF ガン の量子効率は0.2–0.5 × 10⁻⁴,電界放出暗電流は,入 射系 FC で~100 nA (10 nC/pulse)であった.

3月中旬からマイクロトロンへのビーム入射試験を 開始した.ビーム調整には,5ターン目まで配置され ている蛍光板と1ターンと3ターン目に配置された コアモニタ(CM)を使用した.当初は1ターン目の CM は正常に動作せず,調整には使えなかったが,現 在では最も有効なモニタとなっている.その理由は, 我々のビームはシングルバンチであり,25 ターンの全 てのビーム信号がこの1ターン目の CM で観測できる からである(図3).コミッショニング当初は6ター ン目以降のビーム確認は, RTM の主電磁石内でのシ ンクロトロン放射光を観測する SR 光モニタを利用し た.調整当初は透過電荷量が少ないため,放射光が見 えなかったが,3月末には25ターン周回し,初ビーム 加速に成功した.図4にSR光モニタの観測例を示す. ビーム調整を行った者は RTM の調整は初挑戦であっ たが,結果的には1カ月足らずで調整を終え,このシ ステムの運転の容易さを示していると言えるだろう.

6月初旬現在までの最高ビーム電荷量は,91 pC で あり,そのときのビーム透過率は26%であった.こ れはシケインの効果を入れたビームトラッキングの計 算と非常に良く一致した.また,RF ガンで発生した 電界放出暗電流はビームダンプでは観測されなかった.

4. まとめと今後の予定

高品質電子発生装置としてフォトカソード RF 電子 銃とマイクロトロンを組合わせた世界初のシステムを 構築し,エネルギー 150 MeV,電荷量 91 pC の電子 ビームを 10 Hz で発生させることに成功した.このと



図 3: ライナックの軌道上に置かれたコアモニタの出力。



きのビーム透過率は 26 %であり,計算器コードによ る見積もりと良く一致した.

今後はエミッタンス,バンチ長などのモニターを整備し,ビーム性能を測定して設計通りの性能を発揮できるようにより細かい調整を行っていく予定である. また,レーザー加速実験のための予備実験として,Z ピンチプラズマ導波路を用いたプラズマレンズ実験や アンジュレータとフェムト秒レーザーを用いたバンチ スライスによるフェムト秒電子パルスの生成実験などを計画している.

5. 謝辞

マイクロトロン設置と調整に際して,光量子科学研 究センターおよび住友重機械工業の多数の人に援助を 頂きました.また,東京大学の上田氏には実験装置等 を貸して頂きました.この場を借りてお礼を申し上げ ます.

参考文献

- X. J. Wang *et al.*, NIM A 375, p. 82 (1996); D. T. Palmer *et al.*, Proc. of PAC'97; D. T. Palmer, Ph.D Dissertation, Stanford University (1998).
- [2] T. Hori *et al.*, Proc. of the 22th Linear Accel. Meeting in Japan, pp.16–18 (1997).
- [3] M. Kando *et al.*, Proc. of the 1999 Part. Accel. Conf., pp.3702–3704 (1999).
- [4] M. Kando *et al.*, Proc. of the 24th Linear Accel. Meeting in Japan, pp.128–130 (1999).
- [5] M. Sugitani *et al.*, Proc. of the 1st Europ. Part. Accel. Conf. p.596 (1988).
- [6] H. Kotaki et al., in these proceedings.